MODELISATION DE PROCEDES : 1 D, 2 D, STATIQUE OU DYNAMIQUE

BASES & BONNES PRATIQUES

Formation continue courte sur les bases et bonnes pratiques de la modélisation en génie des procédés





CONTEXTE

En génie des procédés, on peut distinguer deux objectifs majeurs à la modélisation :

- (i) l'acquisition et la capitalisation de connaissances, d'une part,
- (ii) (ii) le contrôle et la supervision du procédé, d'autre part.

La formation rappelle les **fondamentaux du génie des procédés** et introduit de manière accessible, pédagogique et ludique les étapes nécessaires pour **la mise en œuvre et la bonne conduite des simulations** dans ce domaine. Le choix ayant été fait de se limiter à des cas simples, cette formation permet de **s'initier à la simulation des procédés** et de **découvrir de grands outils de simulation** professionnels en évitant l'écueil d'un formalisme mathématique.

OBJECTIFS

A la fin de la formation, les stagiaires sauront :

- Sélectionner et piloter un outil professionnel de simulation pour modéliser un procédé simple (COMSOL ASPEN HYSYS)
- Formaliser l'environnement à modéliser (poser les connaissances et les résultats attendus)
- Sélectionner les processus de transferts (matières, énergie, chimie) intervenant dans le procédé étudié
- Etablir des bilans matières et économiques simplifiés
- Analyser et critiquer les résultats obtenus
- Construire et conduire une modélisation 1D, 2D, en mode statique ou dynamique

PUBLIC CONCERNE : Ingénieurs, Master 2, Managers, Chercheurs

LANGUE: Français

NIVEAU: Bases et Bonnes

pratiques

PREREQUIS: Connaissances de base en physique et chimie

DUREE: 2,5 jours

SESSION 2022: 22-24 mai 2023

LIEU: Chimie ParisTech, Paris ou

Teams

TARIFS:

Industriels : 1 700 € Autres : 1200 €

Si hors session (personnalisé) :

2500 €/ jour

ATTESTATION DE SUIVI : Oui

PROGRAMME

| | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 |
|-------------------------|---|--|--|
| Titre | PROCESSUS DE TRANSFERT EN FAMILIARISATION AVEC COMSOL 1D/2D | ETUDE D'UN PROCEDE COMPLET ET SIMULATION SOUS ASPEN HYSYS STATIQUE | ETUDE D'UN REACTEUR SOUS ASPEN HYSYS DYNAMIC |
| Programme matin | Rappels théoriques (3h) Mise en mouvement des fluides et formation / disparition / diffusion des espèces dans les réacteurs chimiques Processus de transfert de chaleur | Rappels théoriques (2h) Opérations unitaires les plus employées dans l'industrie | Tutoriel d'apprentissage (2h) Hysys en mode dynamique Etude de cas (2h) Modélisation et étude du comportement d'un réacteur tubulaire employé pour la synthèse du chlorure d'allyle |
| Programme après-midi | Etude de cas (4h) Modélisation d'un réacteur chimique sous COMSOL 1D /2D Transformation de l'anhydride phtalique en orthoxylène Réacteur Chemical Vapor Deposition pour le dépôt de couche mince de Si (NASA) | Etude de cas (5h) Modélisation du procédé d'élaboration de la cyclohexanone sous Aspen Hysys en statique | |

INTERVENANTS



Cédric GUYONMaître de conférences en génie des procédés

PSL - Institut de Recherche de Chimie Paris

Equipe Procédés, Plasma, Microsystèmes



Frédéric ROUSSEAU

Maître de conférences en génie des procédés

PSL - Institut de Recherche de Chimie Paris

Equipe Procédés, Plasma, Microsystèmes

Contacts:

Pour tous renseignements et inscription, n'hésitez pas à contacter :

Mariane Ighilahriz : mariane.ighilahriz@chimieparistech.psl.eu
0787134097





ParisTech PSL